

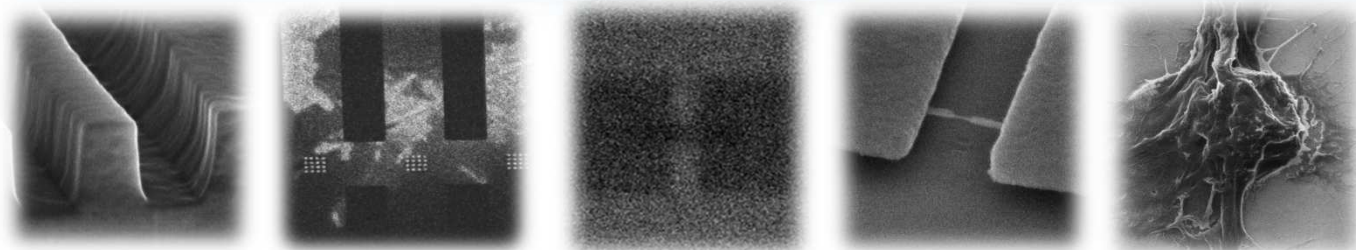
第64回応用物理学会春季学術講演会 シンポジウム

GFIS(電界電離ガスイオン源)ガスイオン顕微鏡技術と その材料・デバイス研究開発への応用:現状と今後の展望

2017年3月16日(木) 13:15 ~ 18:00 会場315 パシフィコ横浜

ヘリウムイオン顕微鏡に代表されるGFIS顕微鏡技術を語るシンポジウムです。
何、それ？そういう方々こそ大歓迎。まだまだ若い技術、何に使い何が出来るか、
多くの分野の方々とその可能性を探る第一歩、この道のパイオニアにその想いを
面白く語って頂きます。一緒に楽しみましょう！
英語での発表ですが、質疑は日本語大歓迎です。

1. Welcome to symposium on GFIS ion microscopy and its applications
Shinichi Ogawa (AIST)
2. The History and New Development of the Helium Ion Microscopy
Technology with ZEISS ORION NanoFab
Yongkai Zhou (Carl Zeiss Microscopy GmbH)
3. Mask Repair Technology using Gas Field Ion Source
Anto Yasaka (Hitachi High-Technologies)
4. Fabrication characteristics of gold films using focused helium ion beam
Etsuo Maeda (University of Tokyo)
5. Development of nanofiber Bragg cavities using helium ion microscope
Hideaki Takashima (Kyoto University)
6. Neon GFIS Gas Assisted Etch and Beam Induced Deposition
- Characterization for Semiconductor Applications -
Richard H. Livengood (Intel Corp.)
7. Single-nanometer patterning of graphene by HIM for advanced applications
Hiroshi Mizuta (JAIST)
8. Nanofabrication of superconducting devices with focused helium ion Irradiation
Shane Cybart (UC Riverside)
9. Direct nano-patterning of graphene by Anderson localization
Yuichi Naito (AIST)
10. Charge transport control in graphene by helium ion irradiation and patterning
Shu Nakaharai (NIMS)
11. Interaction of gas field ionized nitrogen with silicon
Marek E. Schmidt (JAIST)



世話人: 小川真一(産総研)、右田真司(産総研)、水田博(北陸先端大)、中弘周(NIMS)